

# リトリート学習会 2021 プログラム

日程：2021年7月30日（金）～31日（土）

オンライン開催

第1日目	第2日目
<p>9:30-9:40 開会挨拶(10分) 田畑 仁(東大)</p> <p>司会 山本哲也(高知工科大)</p> <p><b>薄膜工学の基礎</b></p> <p>9:40-10:25 <b>薄膜の基礎</b>(45分) 近藤高志(東大)</p> <p>10:30-11:15 <b>薄膜の応用</b>(45分) 北川雅俊(阪大)</p> <p><b>薄膜評価・作製法(1)</b></p> <p>11:20-12:05 <b>力学的・機械的性質の評価</b>(45分) 佐々木信也(東京理科大)</p>	<p>司会 大見俊一郎(東工大)</p> <p><b>薄膜評価・作製法(2)</b></p> <p>9:30-10:15 <b>物理気相成長</b>(45分) 須田 淳(名大)</p> <p>10:20-11:05 <b>化学気相成長</b>(45分) 杉山正和(東大)</p> <p>11:10-11:55 <b>磁性薄膜</b>(45分) 斉藤 伸(東北大)</p>
12:05-13:00 昼休み	11:55-13:00 昼休み
<p>司会 北川雅俊(阪大)</p> <p>13:00-13:20 トピックス①(20分)</p> <p><b>酸化物界面における高移動度二次元 p 型伝導とトランジスタ応用</b> 大矢 忍(東大)</p> <p>13:25-14:10 <b>結晶構造評価</b>(45分) 酒井 朗(阪大)</p> <p><b>薄膜の機能と応用(1)</b></p> <p>14:15-15:00 <b>半導体薄膜 ～シリコン～</b>(45分) 浅野種正(九大)</p> <p>15:00-15:10 休憩(10分)</p> <p>司会 黒田理人(東北大)</p> <p>15:10-15:55 <b>半導体薄膜 ～化合物～</b>(45分) 藤原康文(阪大)</p> <p>16:00-16:45 <b>薄膜の光学的性質</b>(45分) 潮嘉次郎(ニコン)</p> <p>16:50-17:35 <b>誘電体薄膜</b>(45分) 大見俊一郎(東工大)</p>	<p>司会 八瀬清志(産総研)</p> <p>13:00-13:20 トピックス②(20分)</p> <p><b>最先端イメージセンサ技術</b> 黒田理人(東北大)</p> <p>13:25-14:10 <b>組成・状態評価</b>(45分) 宮崎誠一(名大)</p> <p><b>薄膜の機能と応用(2)</b></p> <p>14:15-15:00 <b>有機薄膜</b>(45分) 関谷 毅(阪大)</p> <p>15:00-15:10 休憩(10分)</p> <p>司会 大矢 忍(東大)</p> <p>15:10-15:55 <b>膜厚・形状評価</b>(45分) 田畑 仁(東大)</p> <p>16:00-16:45 <b>薄膜の化学的性質</b>(45分) 徳田 崇(東工大)</p> <p>16:45-16:50 <b>閉会挨拶</b> 山本哲也(高知工科大)</p>